

四方光电股份有限公司

关于对外投资暨签署投资合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：四方光电高端传感器产业基地项目（以下简称“本项目”）
- 投资金额：项目总投资 6 亿元，其中固定资产投入 4 亿元，研发投入 2 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）
- 本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：
 1. 本项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，需根据法定“招、拍、挂”程序取得建设用地。本项目投资、实施是以公司竞得项目用地为前提，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。
 2. 本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评报批、建设工程规划审批等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
 3. 本项目投资金额较大，主要资金来源为自有、自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。
 4. 基于市场变化的不确定性及相关政策的影响，本项目仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司的发展战略规划，为进一步完善公司产业布局，公司拟在武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园投资建设高端传感器产业基地，并与武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心签署《投资合作协议》。本项目总投资 6 亿元，其中固定资产投入 4 亿元，研发投入 2 亿元。（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。

本次投资项目资金来源于自有资金、自筹资金，公司将根据战略规划、经营计划、资金情况和协议约定进行建设，并根据项目实施进度分阶段投入资金。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2025 年 9 月 30 日召开了第三届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议、第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署投资合作协议的议案》。董事会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的事项，包括但不限于就该项目签署相关协议、申报相关审批手续、组织实施该项目等。

本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

名称：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

性质：地方政府机构

负责人：杨志霞

办公地址：武汉市光谷一路光谷建设大厦附楼 2 楼

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，不属于失信被执行人。

三、投资项目基本情况

（一）项目名称：四方光电高端传感器产业基地项目

（二）项目实施主体：四方光电股份有限公司

（三）项目建设地点：武汉东湖新技术开发区

（四）项目投资规模：本项目总投资 6 亿元，其中固定资产投入 4 亿元，研发投入 2 亿元。（最终投资金额以项目建设实际投入为准）

（五）项目选址及用地：本项目初步选址东湖新技术开发区。

四、投资合作协议的主要内容

（一）合同主体

甲方：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

乙方：四方光电股份有限公司

（二）合同内容

乙方计划 2026—2030 年在甲方辖区建设四方光电高端传感器产业基地项目，项目总投资 6 亿元，其中固定资产投入 4 亿元，研发投入 2 亿元。（最终投资金额以项目建设实际投入为准），项目初步选址东湖新技术开发区。

（三）双方权利与义务

在法律法规、国家政策允许范围内，甲方积极支持并协助乙方办理相关政府审批备案手续，提供优质服务。

甲方依法依规为乙方提供优惠支持政策。

乙方承诺项目建设符合国家、湖北省、武汉市、东湖高新区等相关法律法规及政策。

乙方承诺按本协议约定进行投资、经营，保证项目公司获得的本协议约定的支持不得用于项目之外的用途。

乙方承诺在本协议签署后 6 个月内完成项目备案并开工，因政府审批原因（包括但不限于行政审批流程迟延、规划调整、政策变化等非乙方过错情形）导致无法按期完成备案并开工的，前述期限相应顺延。

（四）其他约定内容

1. 双方同意对本协议的存在及其内容和双方之间交流的保密信息保密。

2. 若乙方违反本协议的约定或不履行本协议为其设定的责任和义务，甲方有权终止提供后续所有支持，并有权要求项目公司退回已收到和享受的甲方提供的支持，并承担相应违约责任。

3. 本协议的签署、效力、解释、履行及其争议的解决等均适用中华人民共和国的相关法律（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。

4. 除本协议另有规定外，只有经双方共同以书面形式认同，本协议的所有

条款方可商谈修订。

5. 因本协议发生争议，由双方协商解决，协商不成的，任一方提交武汉仲裁委员会进行仲裁。

6. 本协议由双方签字盖章后生效，一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。本协议的电子扫描件与原件具有同等法律效力。

7. 本协议未尽事宜由双方另行协商，并签订书面补充协议。本协议与补充协议约定不一致之处，以补充协议为准。

五、对外投资对上市公司的影响

通过本次投资，公司将充分利用武汉东湖新技术开发区的优势资源，建设新的总部园区，涵盖研发中心、营销中心和管理中心，同时规划以执行器、控制器为主的制造基地，通过对公司研发与产业化资源的整合，将显著提升公司的研发实力和生产规模，进一步强化企业品牌形象，有力支撑公司战略目标的实现。

本次对外投资不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司后期经营业绩的影响将根据具体项目的推进和实施情况而定。

六、对外投资的风险分析

（一）本项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，需根据法定“招、拍、挂”程序取得建设用地。本项目投资、实施是以公司竞得项目用地为前提，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

（二）本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评报批、建设工程规划审批等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（三）本项目投资金额较大，主要资金来源为自有、自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。

（四）基于市场变化的不确定性及相关政策的影响，本项目仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

公司将根据进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日